1-11

(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

0公開特許公報 (A)

昭54—139065

6DInt. Cl.2 H 05 K 3/00 H 05 K

識別記号 **②日本分類**

59 G 4

庁内整理番号 ◎公開 昭和54年(1979)10月29日

6819-5F

発明の数 1 7638-5F 審査請求 未請求

(全5 百)

SD金属スルーホール型プリント配線板製造用レ ジスト

②持 顧 昭53-45935

3/06

修正 昭53(1978) 4 月20日

②発 明 者 穐山博之

平塚市中原 1 丁目11の17

同 古村正平

宮岡市一ノ宮426の4

中沢二郎 同

横浜市鶴見区東寺尾中台24の15

@発 明 者 原田勲

埼玉県入間郡鶴ケ島町藤金491

の12

の出 願 人 日本スチレンペーパー株式会社

東京都千代田区内幸町2丁目1

番1号

共立工業株式会社 同

東京都千代田区神田駿河台3丁

目6番地の1

四代 理 人 弁理士 板井一環

1. 発明の名称

会員スルーホール型ブリント配線収製造用レジスト

2. 特許請求の範囲

可容性樹脂、鉄可溶性樹脂の溶媒、及び必要に 応じて抵加される不活性固体微粉末から主として なり、汚溶無可能な乾燥無膜を形成することので きる金属スルーホール型プリント配盤板製造のた めの孔部主教用レジストにおいて、これに可能性 樹脂の食溶媒及び/叉は非溶媒であり且つレジス トの加熱花類固度で気化する液体又は上配温度で 分解してガスを発生する化合物を乾燥時の体験変 化率が -10 % 以上であるごとく含有させてなる レクスト。

3. 発明の詳細な質例

本弦明は金属スルーホール設プリント配蓋板の 製造通程で使用するレジストに関するものである。 フェノール樹脂、エポキシ酱脂、ポリカーポネ ート、ポリエステル等、延気絶象性のよいブラス チックからなる準収の表面に無筋等の金属筋から

なるいわゆるプリント配益回路を形成させたプリ ント配線収は、各種電子機器に広く利用されてい る。そして、近年は、集積回路の使用等により高 度に複雑化した回路のために、蒸板の両頭に回路 を形成したものも製作されるようになった。

ところで質菌にブリント配差されたものの場合 は、これにハンダ付する部品の帽子やリード値を 挿入する孔の差面を解等の全異でメッキし、その 孔の位置で西袋面に関路があるとき、これらの間 路が電気的に接続されるようにするのが普通であ る。とのよりな金属メッキされた孔部を宿するブ リント配盤板 -- 全具スルーホール選ブリント配 銀板 ―― は、構造が複雑であるだけに、その製造 には特別の困難性を行う。

すまわち、との夏のブリント配鉄板は通常下記 のような7工程を経て製造されるが、レジストの **土壌による孔部会員メッキ膜の保護がしばしば不・** 見金になり易く、この部分に近エッテングが行わ れてしまりことが多いのである。

② 両面会属指表層美板に配品のリード維持を

特別昭54-139065亿

挿入する孔を穿散する。

Ì

- ③ 穿散された孔にメッキを施す。
- ③ メッキされた孔化レジストを充填し、乾燥する。
- ④ 全属指表面を研磨する。
- ⑤ レジストによる反路パテーンの印刷を施す。
- ⑥ エッテングを行う。
- ⑦ レジストを放去する。

この点につき更に評述すると、第1図のように 孔部に完複されたレジスト1は乾燥すると第2図 いのように収縮し、装面の批下率() × 100) は、レジストの組成や乾燥条件によっても異なるが、通常30多以上に連する。このような乾燥収 縮が苦しい場合は孔部メッキ図の一部が常出し、 一方その上を硬う図路ペターン用レジスト質36 亀姿を生じたり欠落を生じたりする(第3図)。 したがって製出した孔部メッキ異はエッチング工 現で侵され情失してしまうのである(第4図)。 なか各図中、3はプラステック基製、4は金属格 及びメッキ膜である。

び可溶性樹脂の溶剤を主成分とするものであるが、 必須補助成分として発泡剤を含有するととにより、 乾燥時の体養変化率が -10 % 以上であるもので ある。

ことで乾燥時の体表変化率とは、使用状態又は それに近い状態(例えば厚さ2mmのプラスチャク 板に直径2mmの孔を穿設してとこにレジストを光 漬させた状態)で加熱乾燥したときの体表変化率 であり、乾燥前のレジストの体表(すをわち孔部 容表)を V。とし乾燥後のレジストの体表を V と すれば次式で表わされる。

体数数化率 =
$$\frac{V - V_0}{V_0} \times 100$$

体表変化率が0であることはもちろん窟ましいわけであるが、実用上は体表変化率0を目標とするよりも若干部設する特性を持つものとし、乾燥後会異格面より突出した部分を削り落とすようにしたほうがよい。したがって、特に窪ましい体表変化率は0~40%であるが、体表変化率200%を度出のものも使用可能である。一方収量傾向

上述のような原因による孔部メッキ膜の消失を 防ぐには、パメーンレジスト印刷装及びエッチン グ前に入念を検査を行なってレジストの欠陥部を 発見し修正するしかなく、そのために要する時間 と費用は英大なものであった。レジストの改良や 使用方法の工夫により乾燥収縮をまるべく小さく しようとする試みも行われたが、酸化ナメン等の 無料をマロン酸変性ロジンのような樹脂の揮発性 有棣語媒響液中に分散させたよりな貨曲のレジス トなどでは、乾燥等器族の揮発によるある程度の 収縮は避けられず、配合比や乾燥条件を開始する ことによる収益防止効果には凝界があった。そと で本発明者らは、種々検討の結果、潜鉄の焊発化 よる体徴減少分を相駁するに光分を気泡をレジス トの乾燥硬化物中に形成させることに想到し、更 に研究を重ねた前景、以下に静述するような本発 男を充成するに狙ったのである。

₹.

本発明によって提供された新規な孔部充填用レジストは、従来品と同様、不活性固体費粉末(但 しこれは用いない場合もある)、可溶性樹脂、及

を持つものであっても、体積変化率が -10 % 程度性のものは実用上限とんど障害なく使用するととができる。

次に本発明のレジストの構成成分について説明 する。

前述のごとく、不活性因体教粉末、可溶性樹脂 及びその溶剤は本発明のレジスト幹有の構成成分 ではたく、無知のレジスト又はこの種の強料もし くはその類似物の製造化使われるものを適宜適れ 使用することができるか、樹脂及び溶剤について は、所望の発泡解発を形成するよう、用いる発泡 剤の特性に応じて好ましい組合わせがあり得るこ と、もちろんである。

不活性関体をお求はレジストの施制等性を調整すると共化レジストを敵別容易な色質に着色するために用いられるものであり、好ましい具体例としては酸化テタン、強酸パリウム、二酸化建業、酸化マグネシウム、酸化カルシウム等の無機化合物のほか、ナイロン、ポリエステル、ポリエテレン等の有機重合体の微粒子を挙げることができる。

可害性関股とは、後述の高層に可得であると共 に商剤溶液から乾燥した後も同一又は異なる溶剤 (方が変が、した後も同一又は異なる溶剤 の水性媒体を含む)とで可溶液 ものであり、且の孔部に光板でれたレジストがに、 最後を易に崩瘍としての能力を持つのよう。 を発明のレジストはパターン形成用レンストである。 本発明のような大角に、アーン形成用いいでは れを用いると、パイングストであると、 取に前述のような大角にがよったが、 ない、可溶性関がエッチングは、 が異体例としては、変性のジン、変性石油関係、 変性ダンマー酸などがある。

高利としては、これを揮発させるための乾燥工程における加熱機度が基板の耐熱膜界を越えないよう、排点が 150 ℃ 以下のものを用いることが望ましい。もちろんとの答列は使用する発泡剤に対して不活性なものが好ましい。

以上のる成分は本発売のレジストにおいても量

的には通常主成分となるものであり、これらの記 合比は、通常不活性固体教育末0~80多(重量 多、以下同じ)、好せしくは20~70多、可語 性樹脂5~90多、好せしくは10~70多、適 利5~80多、好せしくは10~30多の範囲で 適宜決定する。

本発明のレジストに使用する発泡剤は下記人。 B 2 群の物質の中から選ばれ、あるいは両群の発 泡剤を併用してもよい。

- A: レジストを構成する可溶性樹脂の黄溶膜 又は非溶解でもり且つレジストの加熱乾燥 温度で気化する、他のレジスト構成成分及 び孔部メッキ質に対して不活性な液体。
- B: レジストの加熱乾燥温度で分解してガス 好ましくは不活性なガスを発生する化合物 ・ (化学反応を起としてガスを発生する1以 上の化合物の組み合わせを含む)。

もちろんとれら2群の物質のすべてが本発明の レジストの実用性ある発泡剤になり得るとは限ら ないが、レジストを構成する前配主要3成分の毎

性や最比のいずれるが発泡構造の形成に影響を及. 度すので 発泡剤についての必要特性をこれ以上 一体に規定することは別難である。発泡剤を含む 会レジスト組成は、最終的には実験により、乾燥 時の体積変化率や硬化物の物性等を検討しながら 決定しなければならない。したがって、例示した 揺泡剤の中には使用可能解因が限定されるものも あることに在業しなければならない。

好ましい発信剤の例としては下配のものを挙げ ることができる。

N,N'-ジュテル-N,N'-ジニトロソテレフォルアミド、N,N'-ジニトロソベンタメテレンテトラミン、ジニトロベンタンテトラミン、ジメテルジニトロテレフタルアミド、アゾヒスイソブテロニトリル、ジアゾアミノベンゼン、アゾジカルボン酸パリウム、アゾジカルボンアミド、ベンゼンスルホニルヒドラジド、トルエンスルホニルヒドラジド、ウィド)、コ・ゴージスルホンヒドラジドジ

フェニルスルホン、重旋酸ソーダ、炭酸アン モニウム、重炭酸アンモニウム、カルシウム アジド、過碳酸アンモニウム、シュウ酸第一 鉄、ナトリウムボロハイドライド、トリ クロロエテレン、ジクロロエチレン、ジ クロロフルオロメチン、トリクロロフル オロメチン、テトラクロロジフルオロエチン、 ペークロロエテレン、トリクロロトリフルオ ロエチン、プタン、ペンタン、ペキサン、シ クロペキサン、デトラクロロメタン、ジクロ ロメタン。

本発男のレジストには他に必要に応じて分飲剤、 発泡時剤、着色剤等の補助成分を含有させること ができる。

発性助剤の好ましい具体例としては下記のもの を挙げることができる。

尿素、メチロール尿素、エタノールアミン尿 素等尿素酵媒体、サリテル酸、ステアリン酸、 ラウリン酸、シェウ酸、フタル酸、安息普酸、 ホウ酸、炭酸、マロン酸、タエン酸、フマル

特別和54-139065(j) 複製造を可能にしたものである。

次に実施例を示して本発明を説明する。

夹堆例 1

厚さ L4 mのガラス鐵錐強化エポキシ樹脂板の 両面に網筋を装層してなる板上、四路パターンに 合わせて形成された孔径 1 mの孔(銅メッキ所) 115 個に、下記の組成のレジストを充填する。

張康 パリウム

25 重量器

東化 チョン

20 "

マレイン化ロジン

- 20 -

プチルペンゼンとプトキシエタノールとの混合溶剤 ・

発信剤(ジニトロペンタンナトラミンと尿素の傷合 ...、

次いで 110 ℃ で 60 分間乾燥し、冷却後、解 後して網筋面上に突出したレジスト硬化物を除く と共に網筋表面を研磨し、以後常法によりパター ン印刷、エッチング、レジスト放去を行なってプ リント配額収を得る。

上記のどとくして 300 枚のブリント記載様を

度、コハク酸、アジピン酸、ケイ皮酸、ステ アリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、炭 酸マダネシウム、酸化亜鉛、亜鉛等、硝酸亜 鉛、酢酸亜鉛、グリセリン、非イオン外面活 性剤。

本発明のレジストを用いるブリント配離板の製造法は従来品による場合とほとんど変わらない。 すなわち孔部レジストの元填乾機後の研磨工程 (前配④の工程)にかいて、レジスト硬化物を、 孔の中にある部分は破壊せずに、金属循菌上に突出した部分のみを取り除くよう注意するだけでよい。レジスト硬化物が製剤な気度を包含するものであるため、その溶解除去は使来品の場合よりも 便時間で売了する。

以上の説明から民代明らかなように、本発明の レジストは金属スルーホール型プリント配敵複製 造工程にかいて従来観発していた孔部レジストの 充実不良を歴度完全に解析すると共に、検査・修 正に長する作業量を大幅に減少し製品参信りを向 上させるなど、他事的且つ経済的なプリント配載

製造し、孔部売収レジストについて乾燥時の体積 変化率(無作為に抽出した 100 個所の孔におけ る平均値)を測定した結果、及び製造工程の各数 所における欠陥品の発生率を第1 数に示す。なお、 比較例は、発布剤を含まないレジストを用いた以 外は同様にして製造したものである。

、 無 1	表	
	* #	比较例
体 赞 变 化 率	+1.8 \$	-3 0.0 ≸
パターン印刷欠陥点 ¹	0.2 ≸	21 \$
エッテング後の欠陥品 **2	0.7 \$	15 \$
未放射品多量 ³	92 \$	59 %

- *1 類数鏡鏡祭によって発見された孔部に欠降を有するもののうち、欠陥孔の数が金孔数の 20 %以上あり、手渡し超離と刊定されたものの投入原復に対する割合。
- *2 パターン印刷良品(パターン印刷の欠陥 部を手変ししたものを含む)につきエッチ

ングを行なったとき欠陥部が発見されたも ののペターン印刷良品に対する割合。

- *3 最終的に検査に合格した製品の投入原板 に対する割合。
- 4. 四面の簡単な説明

第1~4 図は使来のレジストを用いたときの欠 陥品の発生を説明する図(新図図)である。

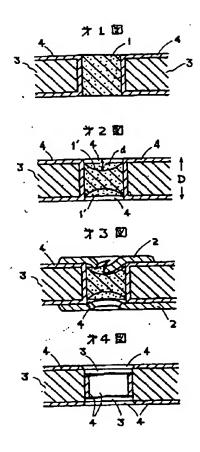
1: レジスト

ま: バターン用レジスト膜

3 : プラステック基板

4: 金属部分

代理人 分類士 枢 井 一 雅



(Item 1 from file: 347) 2/3,AB,LS/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

00487065

RESIST FOR PRODUCTION OF METALIC THROUGH HOLE TYPE PRINTED CIRCUIT BOARD

PUB. NO.:

54-139065 A]

PUBLISHED:

October 29, 1979 (19791029)

INVENTOR(s): AKIYAMA HIROYUKI YOSHIMURA SHOHEI NAKAZAWA JIRO

HARADA ISAO

APPLICANT(s): JAPAN STYRENE PAPER CO LTD [327379] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

KYORITSU KOGYO KK [325639] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

53-045935 [JP 7845935]

FILED:

April 20, 1978 (19780420)

2/3,AB,LS/2 (Item 1 from file: 351) DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

003479908

WPI Acc No: 1982-27870E/198214

Resist compsn. for printed circuit board prodn. - comprises soluble resin, mixed solvent, inactive solid powder and foaming agent (J5 29.10.79)

Patent Assignee: JAPAN STYRENE PAPER CORP (JASY); KYORITSU KOGYO KK (KYOY

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week 198214 B JP 82013160 В 19820315 JP 54139065 19791029 198214 Α

Priority Applications (No Type Date): JP 7845935 A 19780420 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 82013160 В

Abstract (Basic): JP 82013160 B

Resist compsn. consists of soluble resin e.g. maleated rosin, a solvent e.g. a mixed soln. of butylbenzene and butoxyethanol, fine powder of inactive solid material e.g. BaSO4 or TiO2 and a foaming agent e.g. a mixt. of dinitropentane-tetramine and urea. The compsn. is packed into metal-plated through-holes in a printed circuit board.

2/3,AB,LS/3 (Item 1 from file: 345)
DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat
(c) 2001 EPO. All rts. reserv.

Acc no: 2893034

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 54139065 A2 791029

<No. of Patents: 002>

RESIST FOR PRODUCTION OF METALIC THROUGH HOLE TYPE PRINTED CIRCUIT BOARD

(English)

Patent Assignee: JAPAN STYRENE PAPER CORP; KYORITSU KOGYO

Author (Inventor): AKIYAMA HIROYUKI; YOSHIMURA SHIYOUHEI; NAKAZAWA JIROU;

HARADA ISAO

IPC: *H05K-003/00; H05K-003/06
CA Abstract No: *97(10)083722P;
Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 54139065 A2 791029 JP 7845935 A 780420 (BASIC)

JP 82013160 B4 820315 JP 7845935 A 780420

Priority (No, Kind, Date): JP 7845935 A 780420